

Our partner



Ahead Beyond



株式会社 荏原製作所 精密・電子事業カンパニー

〒251-8502 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1
TEL 0466-83-9171 (荏原フィールドテック本社) <https://www.ebara.co.jp>



半導体製造プロセス向け排ガス処理装置

燃焼式排ガス処理装置 TND型、G5型、G6型

高性能ウェットトラップ FST型、ETRAP型、FTRAP型

精密・電子事業カンパニー 海外拠点

USA:
Ebara Technologies Inc
本部: Sacramento(CA)
F S C: Sacramento(CA)
Hillsboro(OR)
S S: San Jose(CA)
Albany (NY)
Newburyport
Boise(ID)

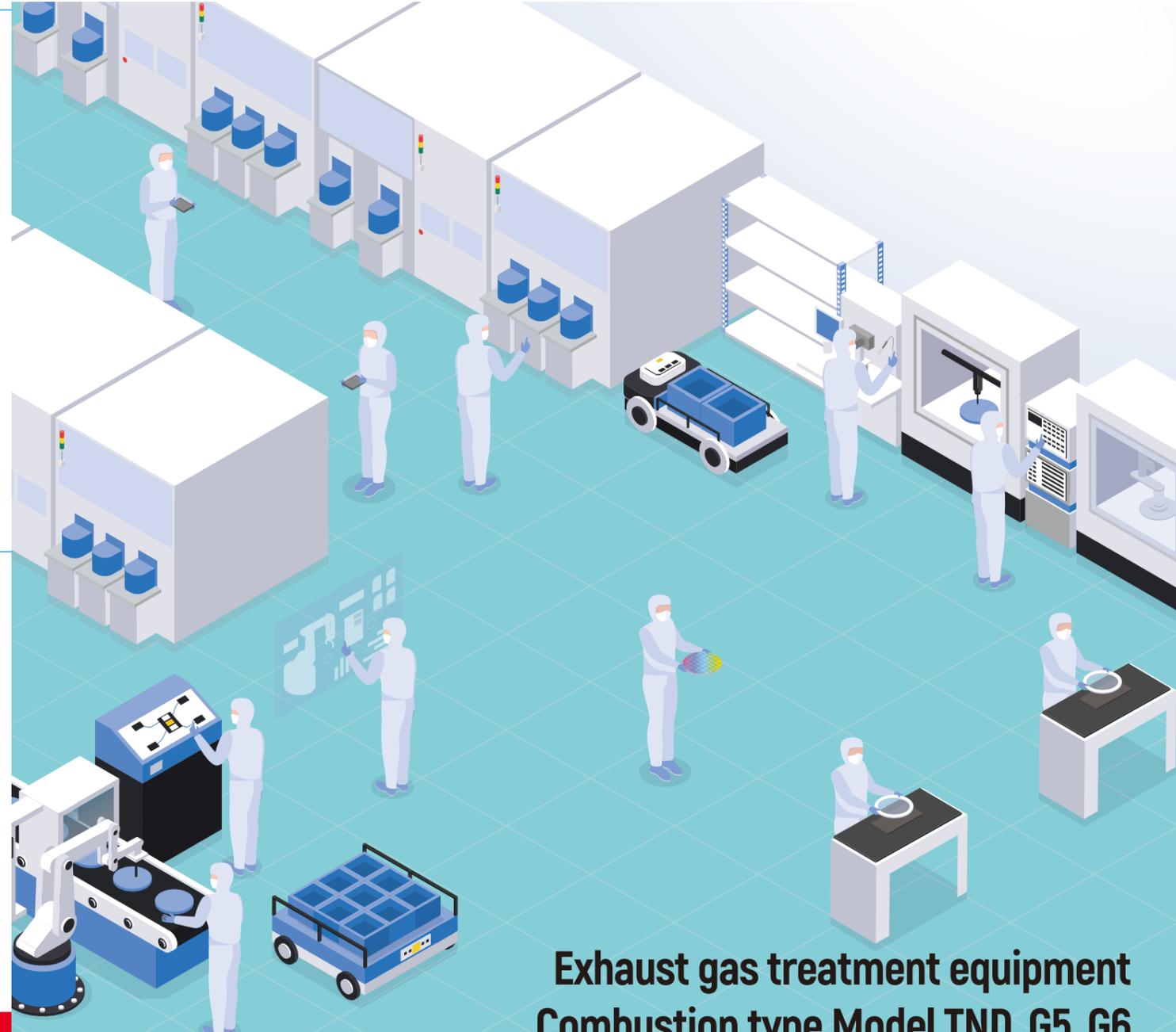
EUROPE:
Ebara Precision Machinery Europe GmbH
本部: Sauerlach, Germany
F S C: Livingston, UK
Dresden, Germany
S S: Graz, Austria

KOREA:
Ebara Precision Machinery Korea Inc
本部: Pyeongtaek
F S C: Pyeongtaek
S S: Seongnam
Hwasung
Cheonan
Icheon
Cheongju

CHINA:
Shanghai Ebara Precision Machinery Co.,LTD
本部: Shanghai
F S C: Shanghai
S S: Wuxi
Dalian
Beijing
Wuhan

SINGAPORE:
Ebara Engineering Singapore Pte.Ltd
本部: Tuas Link
F S C: Tuas Link

TAIWAN:
Ebara Precision Machinery Taiwan Inc
本部: Taipei
F S C: Hukou
S S: Linkou
Hsinchu
Taichung
Tainan



精密・電子事業カンパニー 国内拠点

- 荏原製作所の事業所
藤沢事業所 (藤沢工場 / 精密・藤沢工場)
熊本事業所 (精密・熊本工場)
- 荏原フィールドテックの国内営業・サービス拠点
本社 (荏原製作所藤沢事業所内)
北上事務所
東北事務所 (荏原製作所東北支店内)
山形駐在
藤沢事務所 (荏原製作所藤沢事業所内)
中部事務所
大阪事務所 (荏原製作所大阪支社内)
広島事務所
熊本事務所
長崎事務所
大分事務所
- 荏原フィールドテックのオーバーホール工場
藤沢工場 (荏原製作所藤沢事業所内)
中部工場
鈴鹿工場
九州工場 (荏原製作所熊本事業所内 F 棟)



藤沢工場

Exhaust gas treatment equipment Combustion type Model TND, G5, G6

High performance wet trap Model FST, ETRAP, FTRAP

●このカタログに掲載した製品は「輸出入貿易管理令 別表第1の16項に掲載の貨物」に該当しますので、輸出する場合は「用途」「需要者」などの確認が必要となり場合によっては経済産業大臣の許可が必要となります(これらの要件確認は輸出者においてご確認ください)。また、一部の製品は同管理令 別表第1の1~15項に該当(リスト規制該当品)します。このリスト規制該当品を輸出する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要となりますのでご注意ください。なお、詳細はお手近の弊社の営業所にお問い合わせください。

●ご使用に際しては、取扱説明書に記載の注意事項をよく読み遵守してお取り扱ってください。

●本カタログ記載事項は予告なく変更することがありますので、ご計画に際し詳細は当社宛お問い合わせください。

●本カタログ中の「○○○型」の表示は当社の機種記号です。

●本カタログの内容を無断に転載することを禁じます。



82-045-J01
2022年8月

●本カタログ中の「○○○型」の表示は当社の機種記号です。

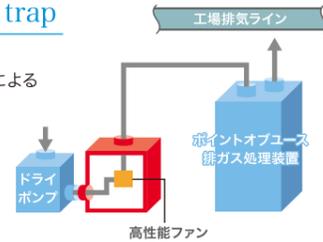
高性能ウェットトラップ FST型, ETRAP型, FTRAP型

ドライ真空ポンプの後段に設置することで排ガス処理装置のメンテナンスサイクルを延長する高性能トラップ。
シンプルな構造でメンテナンス時も素早い対応が可能。当社の燃焼式排ガス処理装置との組合せにより幅広いプロセスへ対応致します。

設置イメージ

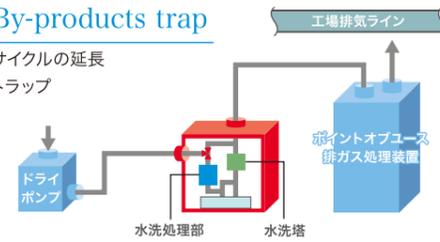
FST型 By-products trap

除害メンテナンスサイクルの延長
ドライ真空ポンプへの直接接続による
後段生成物除去
独自構造による高い除去性能



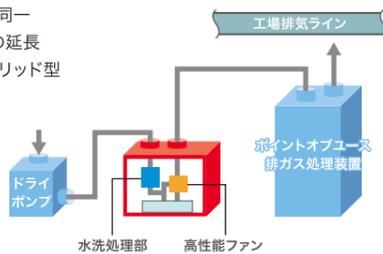
ETRAP型 By-products trap

除害メンテナンスサイクルの延長
高性能ウェット型トラップ



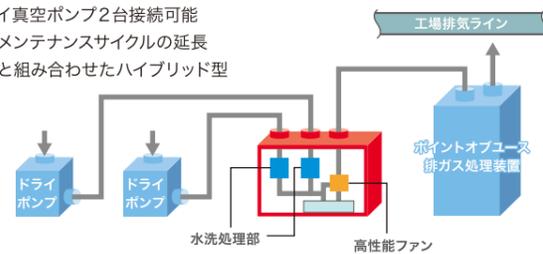
FTRAP-1型 By-products trap

ETRAP型とフットプリント同一
除害メンテナンスサイクルの延長
水洗と組み合わせたハイブリッド型

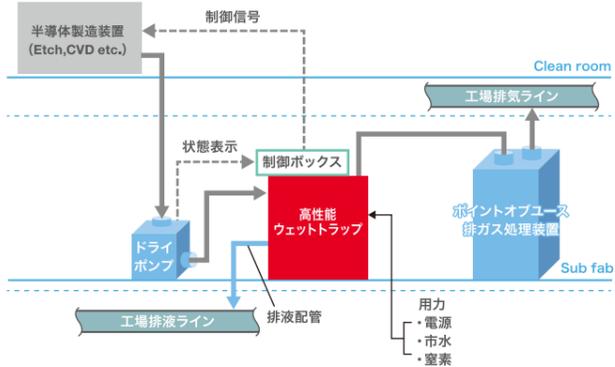


FTRAP-2型 By-products trap

ドライ真空ポンプ2台接続可能
除害メンテナンスサイクルの延長
水洗と組み合わせたハイブリッド型



接続イメージ



※当社製品との組合せにて装置側への制御信号の一括出力可能。

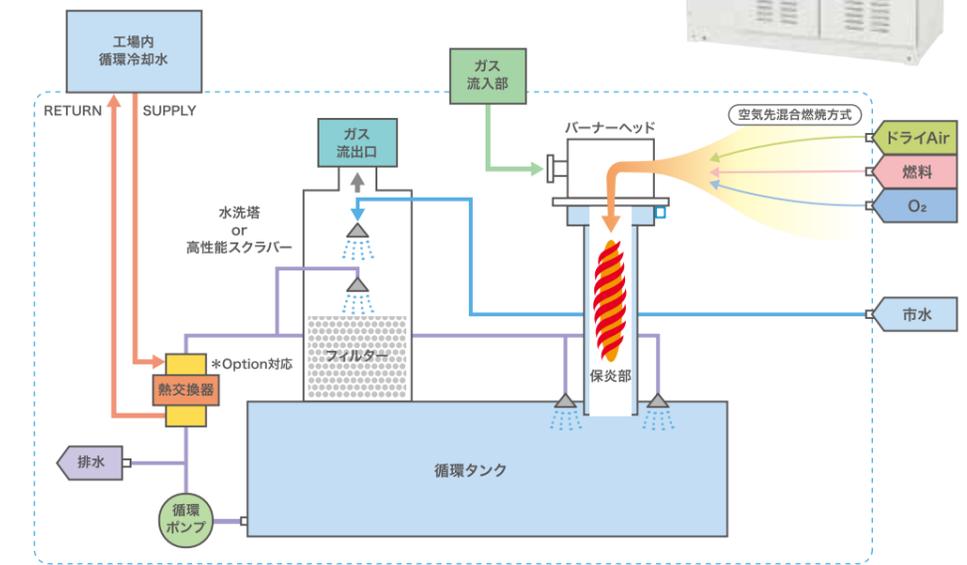
燃焼式排ガス処理装置 TND型, G5型, G6型

半導体製造工程で発生する様々な有害ガスや地球温暖化の原因となるPFCsガスを分解する燃焼式排ガス処理装置です。
高効率の燃焼技術、熱交換器による省水量機能によってユーティリティコストを削減し、お客様のコストオペナーシップへ貢献致します。
また最先端プロセスでの豊富な経験からメンテナンスサイクルの長期化を実現致します。弊社独自の燃焼技術により地球温暖化ガスを処理し、半導体製造プロセスでのSDGsへの貢献を実現致します。

TND型



TND型 概略フロー図



G5型



仕様表

型式	最大ガス流入量 (L/min)	流入口数	寸法(mm)	生成物対策			推奨プロセス				
				前段湿式部	バーナー水洗浄	スクレーパ	CVD	Etching	Asher	Epitaxial	PV
G5-A4	G5-350	350	~4	W1,200 x D650 x H1,900			○	○	○	○	
	G5-500	500	~4	W1,200 x D650 x H1,900			○	○	○	○	
	G5-600	600	~4	W1,200 x D1,100 x H2,000			○	○	○	○	
G5-A6	G5-1200	1200	~6	W1,200 x D1,100 x H2,200			○	○	○	○	
G6-E-A4	400	~4	W1,260 x D910 x H1,930			○	○			○	
G6-PV-A4	1200	~4	W1,200 x D1,880 x H2,300			○	○				○
TND-Single	400	~4	W1,200 x D650 x H1,980	○	○	○	○	○	○	○	
TND-Single Plus	-A2	400	~2	W1,200 x D650 x H1,980	○	○	○	○	○	○	○
	-A8	400	~8	W1,200 x D1,150 x H1,980	○	○	○	○	○	○	○
	-A4	800	~4	W1,600 x D850 x H1,980	○	○	○	○	○	○	○
TND-Double	800	~4+4	W1,800 x D650 x H1,980	○	○	○	○	○	○	○	
TND-Dual	800	~6+6	W1,860 x D750 x H1,980	○	○	○	○	○	○	○	

仕様表

型式	最大ガス流入量 (L/min)	流入口数	寸法(mm)	処理方式		推奨プロセス							特徴
				水洗塔	高性能ファン	CVD			Etching		Asher	Epitaxial	
						SiO ₂ (HCD/DCS)	TiO ₂ (TiCl ₄)	WO ₃ (WF ₆)	SiO ₂ (SiF ₄)	B ₂ O ₃ (BCl ₃)	NH ₃	SiO ₂ (DCS)	
FST	400	1	W400 x D390 x H1,026		○	○	○			○	○	ドライ真空ポンプ直結型	
ETRAP	400	1	W640 x D640 x H1,980	○	○	○	○	○	○	○	○	低コストタイプ	
FTRAP-1	180	1	W900 x D700 x H1,980		○	○	○	○	○	○	○	生成物の除去率が高い	
FTRAP-2	360	2	W900 x D700 x H1,980		○	○	○	○	○	○	○	生成物の除去率が高い	

※高性能ウェットトラップの後段に適切な排ガス処理装置を設置して下さい。 ※詳細な使用条件は弊社までお問合せ下さい。 ※半導体製造プロセス以外でご検討の場合、弊社までお問合せ下さい。